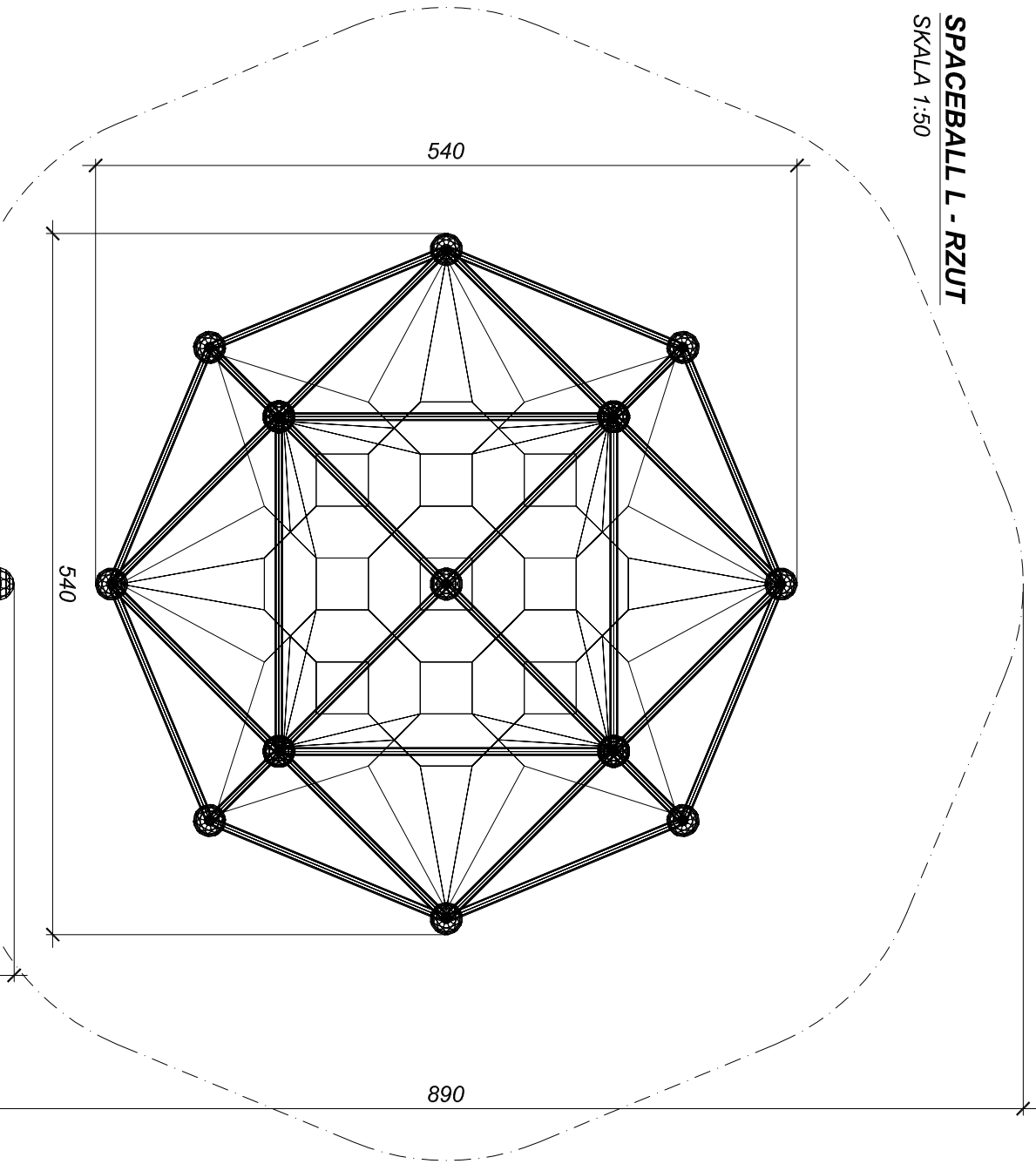


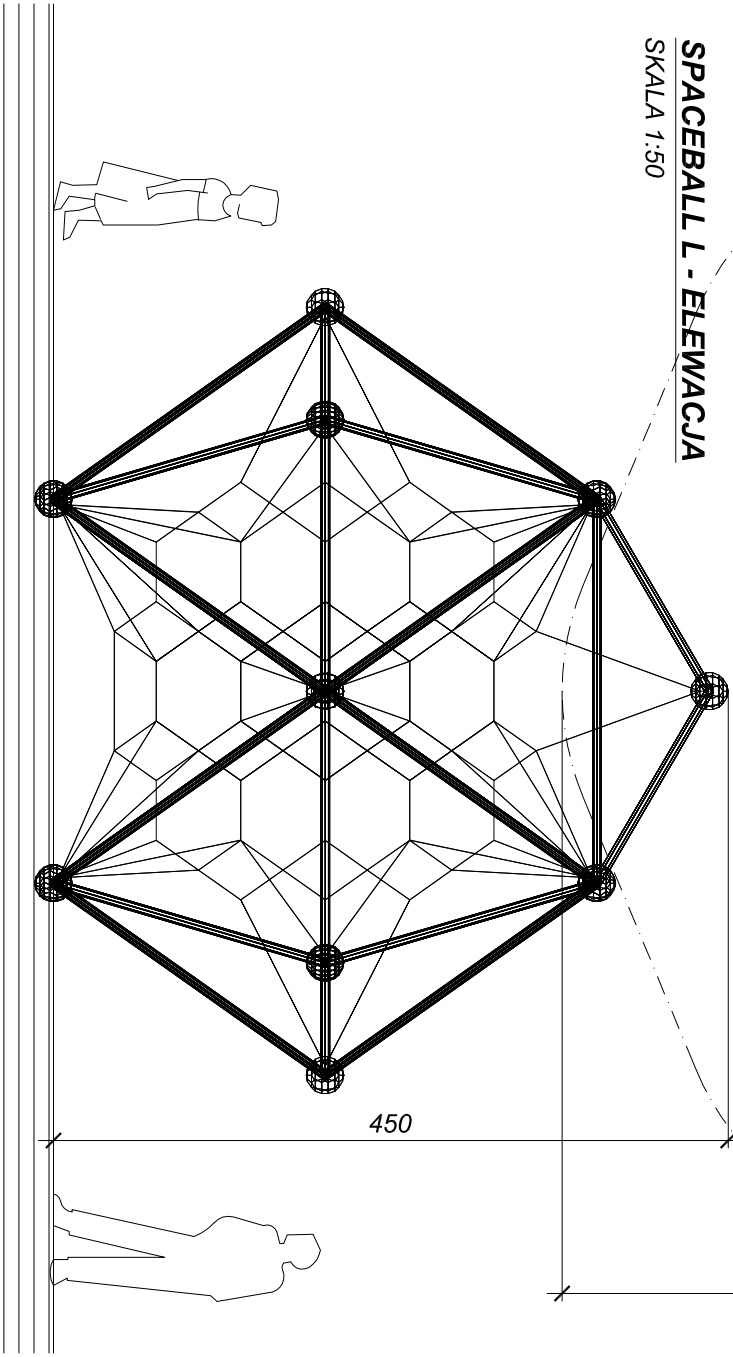
SPACEBALL L - RZUT

SKALA 1:50



SPACEBALL L - ELEWACJA

SKALA 1:50

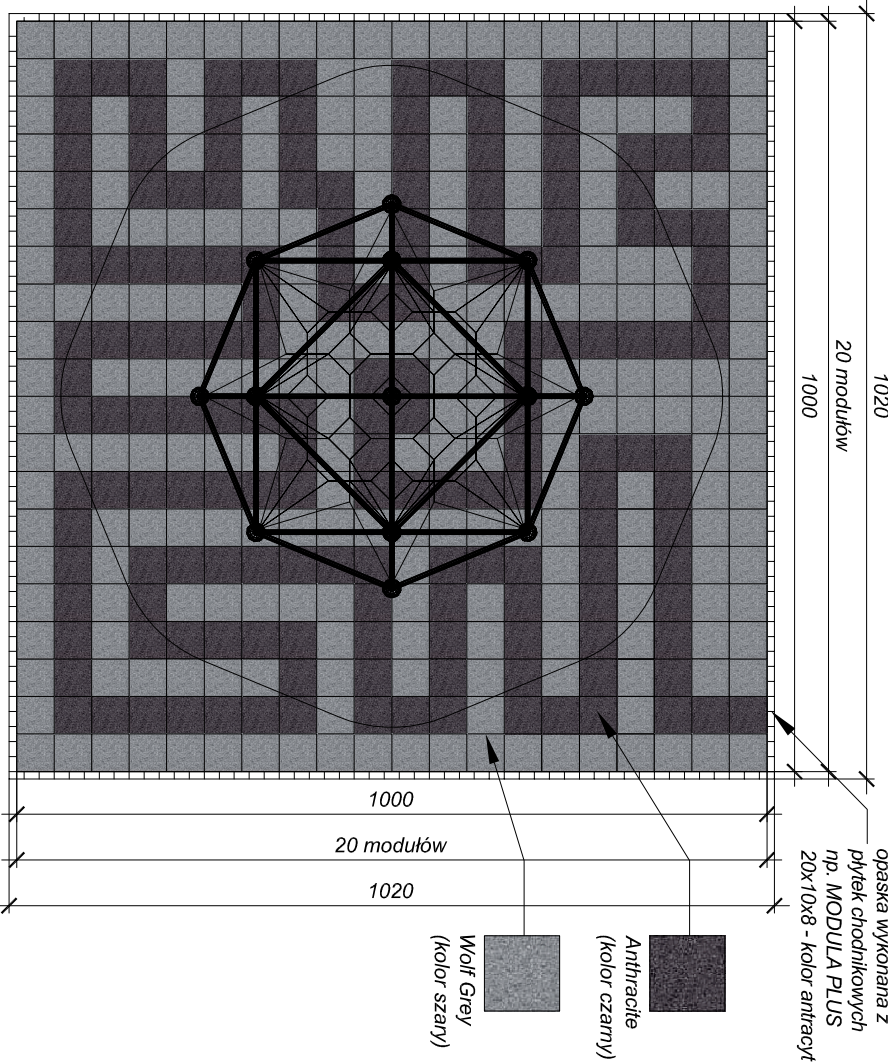


LINEARIUM SPACEBALL L

Linearium SPACEBALL L to urządzenie sprawnościowe dla dzieciw różnym przedziale wiekowym. Wysokość swobodnego upadku wynosi 1,85m.

RZUT POSADZKI POD LINEARIUM

SKALA 1:100



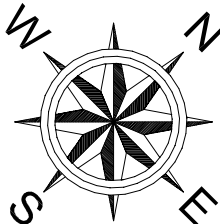
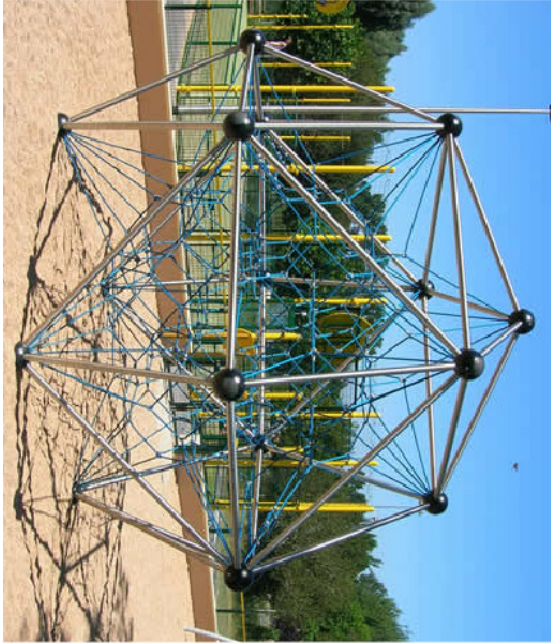
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA NP. FLEXANA gr. 80 mm

FLEXANA

FLEXANA przeznaczona jest na nawierzchnie bezpieczne placów zabaw, obiektów rekreacyjnych i sportowych. Zmniejsza ryzyko występowania urazów, zapewniając bezpieczeństwo i dostęp do urządzeń dla wszystkich. FLEXANA jest bezspoinową nawierzchnią wykonaną w miejscu wbudowania. Zbudowana jest z dwóch warstw granulatu gumowego. Spodniego - nadającego nawierzchni odpowiednią elastyczność - pochodzącego z recyklingu i wierzchniego - nadającego nawierzchni odpowiedni efekt wizualny - z granulatu EPDM lub barwionego powierzchniowo czarnego granulatu gumowego połączonego klejem poliuretanowym. Nawierzchnia bezpieczna FLEXANA jest elastyczna, twarda oraz przepuszczalna dla wody. Grubość nawierzchni FLEXANA wynosi od 20 do 120 mm w zależności od przeznaczenia i wymagań, które ma spełnić. Nawierzchnia jest przeznaczona do pokrywania tych miejsc w których istnieje zwiększone ryzyko upadku, posiada Atest Higieniczny oraz certyfikat bezpieczeństwa upadku z wysokości do 2,0m przy grubości płytki 80 mm.

KOSMICZNE LINEARIUM

Np. Z oferty firmy ARSPRAY producent: Berliner Seilfabrik typ SPACEBALL L nr katalogowy 90.100.111 Do projektu zaleca się wersję ze stali nierdzewnej.



PRZEBUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE  
PLACU REKREACYJNEGO PRZY  
UL.SIKORSKIEGO W REWALU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
**STUDIO PROJEKTOWE  
WOJCIECH BAL**  
Plec Orła Białego 7/1  
70-562 Szczecin  
NIP: 851-161-81-36



INWESTOR:  
**URZĄD GMINY REWAL**  
ul. Mickiewicza 19, 71-344 Rewal

PRACOWNIA:  
**LINEARIUM**  
PROJEKT KONCEPCYJNY  
KOREKTA

PRACOWNIA:  
**ARCHITEKTURA**

mgr inż.arch. Justyna Markiewicz

SKALA:  
**1:50 i 1:100**

DATA:  
**marzec 2012**

OPRACOWANIE POLEGA OCHRONIE NA POSTAWIE USTAWY  
O PRAWIE AUTORSKIM, KOPLOWANIE ORAZ WYSZKIE  
WYKONANIE ZDROJÓW, JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE.